

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Februar 2001 (15.02.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/11320 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01D 5/347, G02B 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/06772

(22) Internationales Anmeldedatum:
15. Juli 2000 (15.07.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
199 37 023.0 5. August 1999 (05.08.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): DR. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH [DE/DE]; Postfach 12 60, D-83292 Traunreut (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEIDMANN, Josef [DE/DE]; Kramerstrasse 10, D-83224 Grassau (DE). SPECKBACHER, Peter [DE/DE]; Blumenstrasse 3a, D-84558 Kirchweidach (DE).

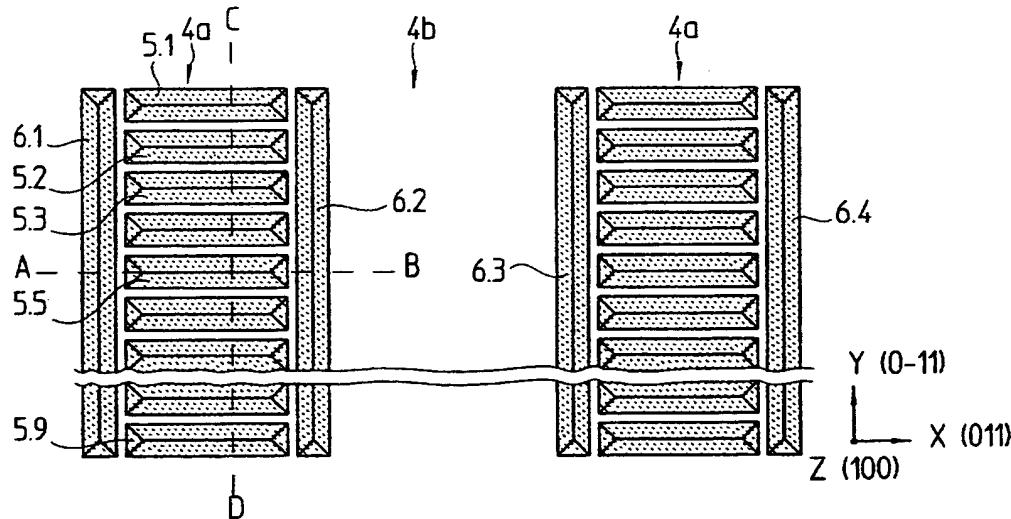
(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: REFLECTION MATERIAL MEASURE AND METHOD FOR PRODUCING A REFLECTION MATERIAL MEASURE

(54) Bezeichnung: REFLEXIONS-MASSVERKÖRPERUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER RELEXIONS-MASSVERKÖRPERUNG

**11320 A1**

(57) Abstract: The invention relates to a reflection material measure and to a method for producing a reflection material measure. The reflection material measure consists of first and second partial regions having different optical reflection properties that extend in a first direction on a silicon substrate. The less reflective first partial regions are comprised of a plurality of inclined surfaces which are arranged in such a manner that no retroreflection of incident light beams results. The inclined surfaces are configured approximately as a plurality of adjacent V-channels, which are arranged in a second direction that is preferably perpendicular to the first direction. Alternatively, it is possible to configure a deeply etched pyramid structure in the first partial regions.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Reflexions-Massverkörperung sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Reflexions-Massverkörperung angegeben. Diese besteht aus ersten und zweiten Teilbereichen mit unterschiedlichen optischen Reflexionseigenschaften, die sich in einer ersten Richtung auf einem



Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.